

Intel, 중국공장에 45나노미터 기술 적용

Intel이 2010년 완공 예정인 중국 Dalian 공장에 65나노미터 또는 45나노미터 기술을 적용해 반도체를 생산할 계획이다.

샤터런 Dalian 시장은 “Intel이 65나노미터 또는 4나노미터 생산기술을 Dalian공장에 적용할 것이 확실시돼 세계적 수준의 연구개발 시설을 갖출 계획”이라고 밝혔다.

반도체는 회로의 폭이 가늘면 가늘수록 첨단제품에 속한다.

Intel이 2007년 3월 25억달러(약 2조3000억원)를 투자해 Dalian에 아시아 최초의 공장을 건설하겠다는 계획을 발표했는데 공장에 적용할 기술수준으로 언급한 90나노미터기술보다 1-2단계 상향된 것이다.

2005년 말 65나노미터 기술을 처음 선보였던 Intel은 2006년 6월 아일랜드에 65나노미터 반도체 공장을 건설해 양산에 들어갔으며 2007년 하반기에는 1단계 향상된 45나노미터 기술을 적용한 반도체를 내놓을 계획이다.

<화학저널 2007/06/22>